

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第6部門第3区分  
 【発行日】平成18年7月13日(2006.7.13)

【公開番号】特開2001-75628(P2001-75628A)

【公開日】平成13年3月23日(2001.3.23)

【出願番号】特願平11-247464

【国際特許分類】

<b>G 05 B</b>	<b>19/418</b>	<b>(2006.01)</b>
<b>B 23 Q</b>	<b>41/08</b>	<b>(2006.01)</b>
<b>H 01 L</b>	<b>21/02</b>	<b>(2006.01)</b>

【F I】

<b>G 05 B</b>	<b>19/418</b>	<b>Z</b>
<b>B 23 Q</b>	<b>41/08</b>	<b>Z</b>
<b>H 01 L</b>	<b>21/02</b>	<b>Z</b>

【手続補正書】

【提出日】平成18年5月31日(2006.5.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体製造プロセスを実行する少なくとも一つの処理チャンバを含む処理システムと、

上記処理システムの上記処理チャンバに処理対象物を出し入れする搬送システムと、

上記処理システム及び上記搬送システムの機械制御部に電気的に接続され、装置制御プログラム及び装置動作条件パラメータを格納する記憶装置を有し、上記機械制御部に上記装置制御プログラム及び上記装置動作条件パラメータを供給する機器制御システムとにより構成され、

上記機械制御部は上記機器制御システムから供給された上記装置制御プログラム及びメモリに展開された上記装置動作条件パラメータに基づいて上記処理システム及び上記搬送システムを制御する半導体製造装置において、

上記機器制御システムは、上記装置動作条件パラメータを、上記半導体製造装置に固有の標準的なレベルから上記半導体製造装置のユーザに固有の特殊なレベルまでの優先度を付けられたレベル毎に上記記憶装置に格納し、

上記機器制御システムは、上記機器制御システムの上記記憶装置に格納された上記装置動作条件パラメータを、上記パラメータの組の優先度に応じて上記メモリに展開することを特徴とする、半導体製造装置。

【請求項2】半導体製造プロセスを実行する少なくとも一つの処理チャンバを含む処理システムと、

上記処理システムの上記処理チャンバに処理対象物を出し入れする搬送システムと、

上記処理システム及び上記搬送システムの機械制御部に電気的に接続され、装置制御プログラム及び装置動作条件パラメータを格納する記憶装置を有し、上記機械制御部に上記装置制御プログラム及び上記装置動作条件パラメータを供給する機器制御システムとにより構成され、

上記機械制御部は上記機器制御システムから供給された上記装置制御プログラム及びメモリに展開された上記装置動作条件パラメータに基づいて上記処理システム及び上記搬送システムを制御する半導体製造装置において装置動作条件パラメータを管理する方法であ

つて、

上記装置動作条件パラメータを、上記半導体製造装置に固有の標準的なレベルから上記半導体製造装置のユーザに固有の特殊なレベルまでの優先度を付けられたレベル毎に上記記憶装置に格納する工程と、

上記機器制御システムの上記記憶装置に格納された上記装置動作条件パラメータを上記パラメータの組の優先度の順番に上記メモリに展開する工程とを具備することを特徴とする方法。

【請求項3】 上記装置動作条件パラメータを上記パラメータの組の優先度の順番に上記メモリに展開する工程は、

最も優先度の高いレベルのパラメータの組を上記メモリに展開する工程と、

次に優先度の高いレベルのパラメータの組が上記記憶装置から取得できなくなるまで、既に上記メモリに展開されたパラメータと同じ項目のパラメータが上書きされるように、次に優先度の高いレベルのパラメータの組を上記メモリに展開する工程とを有することを特徴とする請求項2記載の方法。

【請求項4】 上記装置動作条件パラメータを上記パラメータの組の優先度の順番に上記メモリに展開する工程は、

最も優先度の低いレベルのパラメータの組を上記メモリに展開する工程と、

次に優先度の低いレベルのパラメータの組が上記記憶装置から取得できなくなるまで、次に優先度の低いレベルのパラメータの組の中で既に上記メモリに展開されたパラメータと同じ項目のパラメータ以外のパラメータを上記メモリに展開する工程とを有することを特徴とする請求項2記載の方法。

【請求項5】 半導体製造プロセスを実行する少なくとも一つの処理チャンバを含む処理システムと、

上記処理システムの上記処理チャンバに処理対象物を出し入れする搬送システムと、

上記処理システム及び上記搬送システムの機械制御部に電気的に接続され、装置制御プログラム及び装置動作条件パラメータを格納する記憶装置を有し、上記機械制御部に上記装置制御プログラム及び上記装置動作条件パラメータを供給する機器制御システムとにより構成され、

上記機械制御部は上記機器制御システムから供給された上記装置制御プログラム及びメモリに展開された上記装置動作条件パラメータに基づいて上記処理システム及び上記搬送システムを制御する半導体製造装置において、

上記装置動作条件パラメータを管理する動作をコンピュータにさせるプログラムを記録した記録媒体であって、

当該プログラムは、

上記装置動作条件パラメータを、上記半導体製造装置に固有の標準的なレベルから上記半導体製造装置のユーザに固有の特殊なレベルまでの優先度を付けられたレベル毎に上記記憶装置に格納する工程と、

上記機器制御システムの上記記憶装置に格納された上記装置動作条件パラメータを上記パラメータの組の優先度の順番に上記メモリに展開する工程とを具備することを特徴とする記録媒体。

【請求項6】 上記装置動作条件パラメータを上記パラメータの組の優先度の順番に上記メモリに展開する工程は、

最も優先度の高いレベルのパラメータの組を上記メモリに展開する工程と、

次に優先度の高いレベルのパラメータの組が上記記憶装置から取得できなくなるまで、既に上記メモリに展開されたパラメータと同じ項目のパラメータが上書きされるように、次に優先度の高いレベルのパラメータの組を上記メモリに展開する工程とを有することを特徴とする請求項5記載の記録媒体。

【請求項7】 上記装置動作条件パラメータを上記パラメータの組の優先度の順番に上記メモリに展開する工程は、

最も優先度の低いレベルのパラメータの組を上記メモリに展開する工程と、

次に優先度の低いレベルのパラメータの組が上記記憶装置から取得できなくなるまで、  
次に優先度の低いレベルのパラメータの組の中で既に上記メモリに展開されたパラメータ  
と同じ項目のパラメータ以外のパラメータを上記メモリに展開する工程とを有することを  
特徴とする請求項5記載の記録媒体。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0014】

請求項4に記載された本発明の装置動作条件パラメータの管理方法によれば、上記装置動作条件パラメータを上記パラメータの組の優先度の順番に上記メモリに展開する工程は

、最も優先度の低いレベルのパラメータの組を上記メモリに展開する工程と、

次に優先度の低いレベルのパラメータの組が上記記憶装置から取得できなくなるまで、  
次に優先度の低いレベルのパラメータの組の中で既に上記メモリに展開されたパラメータ  
と同じ項目のパラメータ以外のパラメータを上記メモリに展開する工程とを有することを  
特徴とする。

請求項5に記載された本発明の記録媒体は、半導体製造プロセスを実行する少なくとも  
一つの処理チャンバを含む処理システムと、上記処理システムの上記処理チャンバに処理  
対象物を出し入れする搬送システムと、上記処理システム及び上記搬送システムの機械制  
御部に電気的に接続され、装置制御プログラム及び装置動作条件パラメータを格納する記  
憶装置を有し、上記機械制御部に上記装置制御プログラム及び上記装置動作条件パラメー  
タを供給する機器制御システムとにより構成され、上記機械制御部は上記機器制御システ  
ムから供給された上記装置制御プログラム及びメモリに展開された上記装置動作条件パラ  
メータに基づいて上記処理システム及び上記搬送システムを制御する半導体製造装置にお  
いて、上記装置動作条件パラメータを管理する動作をコンピュータにさせるプログラムを  
記録した記録媒体であって、当該プログラムは、上記装置動作条件パラメータを、上記半  
導体製造装置に固有の標準的なレベルから上記半導体製造装置のユーザに固有の特殊なレ  
ベルまでの優先度を付けられたレベル毎に上記記憶装置に格納する工程と、上記機器制御  
システムの上記記憶装置に格納された上記装置動作条件パラメータを上記パラメータの組  
の優先度の順番に上記メモリに展開する工程とを具備することを特徴とする。